15

Измерение микроколичеств титана на развитой поверхности кремния с помощью ячеек на основе перфторированных протонпроводящих мембран

© С.Е. Никитин,¹ Е.И. Теруков,¹ О.И. Коньков,¹ А.В. Бобыль,¹ С.В. Тимофеев²

 ¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия
 ² ОАО "Пластполимер", 195197 Санкт-Петербург, Россия e-mail: nikitin@mail.ioffe.ru

(Поступило в Редакцию 23 августа 2012 г.)

Исследована методика измерения микроколичеств титана, находящегося на развитой поверхности кремния. Методика основана на растворении тонких слоев Ті в водных растворах фтористоводородной кислоты с последующим анализом полученных растворов с помощью потенциометрических ячеек на основе перфторированных протонпроводящих мембран. Показана возможность количественного определения не менее 5 · 10⁻⁷ mol титана на поверхности кремния.

Введение

Структуры Si-Ti широко используются в электронной технике. Тонкие слои титана и его силицидов широко применяются в качестве соединительных линий и контактных площадок в микроэлектронных устройствах. Такие структуры формируются путем осаждения титана на кремний с последующим отжигом для получения слоев TiSi₂ [1]. Перспективным также является использование наноструктурированного TiSi2 в качестве фотокатализатора [2]. В этом случае осаждение титана и формирование TiSi₂ происходит на сложных поверхностях. В связи с этим существует необходимость определения микроколичеств Ті на развитых поверхностях кремния. Интерференционные способы измерения толщин пленок, а следовательно и количества вещества, требуют гладких поверхностей и мало пригодны, поскольку Ti и TiSi2 обладают металлическими свойствами. Резонансночастотная методика неприменима в случае осаждения пленок титана методами химического парафазного осаждения (CVD). Электронно-микроскопические способы определения толщин пленок на шероховатых поверхностях также наталкиваются на трудности, о чем подробно будет сказано далее. Альтернативой этим способам может быть методика, основанная на растворении осажденного титана в растворе HF с последующим анализом полученного раствора в специальной потенциометрической ячейке. В основе методики лежит то обстоятельство, что кремний нерастворим в плавиковой кислоте, в то время как титан быстро растворяется даже в разбавленных водных растворах этой кислоты. Растворение Ті происходит по реакции:

$$Ti + 6HF = H_2[TiF_6] + 2H_2,$$
 (1)

а кремний, нерастворимый в HF, остается в твердой фазе. В результате в растворе изменяются концентрации

ионов F^- и H^+ , а также появляются ионы $[TiF_6]^{-2}$. По изменению концентрации любого из этих ионов в принципе можно оценивать количество молей участвующего в этой реакции титана. В настоящее время известны сенсоры для измерения концентраций ионов F⁻ и H⁺. К ним относятся электроды для измерения концентрации ионов F^- на основе LaF₃, а также стеклянные электроды для измерения концентрации ионов H⁺. Электроды на основе LaF₃ для измерения концентрации ионов F- могут использоваться при концентрации ионов H^+ не более $3.1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. Остается возможность измерения количества титана по изменению концентрации ионов Н⁺ в результате реакции (1). Однако стеклянные электроды невозможно использовать для измерения концентрации ионов H⁺ в растворах фтористоводородной кислоты. Измерение концентрации ионов Н⁺ и, следовательно, количества растворенного титана производилось в двухкамерных потенциометрических ячейках, где в качестве сенсоров использовались мембранно-электродные блоки на основе перфторированных протонпроводящих мембран [3]. Мембранно-электродные блоки (МЭБ) были изготовлены из перфторированных протонпроводящих мембран МФ-4СК, на обе стороны которых наносились пористые слои платины [4]. Выбор сенсора связан с тем, что МЭБ на основе мембран МФ-4СК обладают высокой протонной проводимостью, химической устойчивостью в водных растворах HF и хорошими прочностными свойствами, что позволяет осуществить герметизацию измерительной ячейки. Если в камеры ячейки, разделенные МЭБ, поместить два водных раствора с разной концентрацией ионов Н⁺, на электродах этой ячейки возникнет ЭДС. Возникновение ЭДС обусловлено преимущественно протонной проводимостью мембраны. Возникающая ЭДС останавливает поток протонов через мембрану из раствора с большей концентрацией протонов в раствор с их меньшей концентрацией. В связи с этим положительный потенциал накапливается на электроде, контактирующем с раствором с меньшей концентрацией протонов. Значение ЭДС определяется соотношением концентраций протонов в камерах ячейки. Величину концентрационной ЭДС можно оценить по формуле Нернста для разбавленных растворов

$$E = \frac{RT}{zF} \ln \frac{C_2}{C_1},\tag{2}$$

где $R = 8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1}$ — универсальная газовая постоянная, T — температура, K, z — заряд иона водорода H⁺, $F = 96485.33 \,\mathrm{C}\,\mathrm{mol}^{-1}$ — постоянная Фарадея, C_1 и C_2 — концентрации протонов в растворах (mol/dm³).

При T = 298 K и соотношении концентраций ионов H^+ $C_2/C_1 = 2$ расчетное значение ЭДС составляет 17.7 mV.

Экспериментальная потенциометрическая ячейка представляла собой две фторопластовые камеры объемом 1 сm³, между которыми был герметично зажат МЭБ, представляявший собой ленту длиной 10 и шириной 2 сm. Толщина мембраны составляла около 200 μ m, толщина платиновых электродов слоев составляла $\approx 5 \,\mu$ m. Каждая из камер была снабжена устройством для перемешивания растворов. Напряжение снималось с электродов МЭБ.

Работоспособность и чувствительность этой методики исследованы в работе [5], где измерена зависимость ЭДС, возникающая в ячейке, в камерах которой находились водные растворы с различными концентрациями HF. Концентрация одного из растворов C1 была точно известна и не изменялась во всех измерениях. Этот раствор использовался в качестве раствора сравнения (РС). Концентрация второго раствора С₂ варьировалась в интервале от $C_2 = 1.4C_1$ до $C_2 \approx 10^2 C_1$. При небольших разностях концентраций ($C_2/C_1 \le 5$) экспериментальное значение ЭДС согласуется с расчетом по формуле (2). При большей разности концентраций измеренное значение ЭДС меньше расчетного. При разности концентраций более чем в 100 раз электродная функция сенсора исчезает. Различия между измеренными и вычисленными по формуле Нернста значениями ЭДС связаны с необменным поглощением соответствующего электролита и диффузией электролита через мембрану [6,7]. Отметим, что с увеличением концентрации степень диссоциации HF уменьшается [8], что также приводит к различию между экспериментальным и расчетным значениями ЭДС.

Поскольку в результате реакции (1) меняется концентрация ионов H^+ , можно построить калибровочную зависимость ЭДС от количества Ті, прореагировавшего в ходе этой реакции. Для этого готовился набор образцов с известным количеством осажденного титана.

Приготовление образцов, электронно-микроскопическое исследование их поверхности и определение микроколичества титана на шероховатой поверхности кремния

Для приготовления образцов с известными количествами Ті использовались стандартные полированные пластины кремния с размерами 5×5 cm, на которые методом магнетронного распыления осаждался титан. Режим напыления титана на полированные пластины был следующий: напряжение разряда — 600 V, ток разряда — 200 mA, магнитное поле на поверхности мишени 0.1 Т, давление аргона в камере — 1.33 Ра, время напыления 10 min. Измерение толщины осажденного слоя титана и исследование морфологии поверхности образцов проводилось с использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM) JSM 7001F при напряжении 2-5 kV с разрешением 3-5 nm. Прибор оснащен энергодисперсионным полупроводниковым спектрометром (EDS) для микрорентгеноспектрального анализа по всем элементам, начиная с бора. Анализ элементного состава поверхностей проводился при ускоряющем напряжении 15 kV. Элементный состав определялся штатной программой микроскопа, использующей внутренний приборный эталон. Микроизображение скола такого образца показано на рис. 1. Толщина слоя титана составляла 300 ± 15 nm. Из рисунка видно, что определение толщины пленок титана на полированных поверхностях не представляет проблем. Отметим, что пленки, полученные методом магнетронного распыления на гладкой поверхности, по своей плотности приближаются к объемным образцам. Поэтому количество молей титана N, содержащегося в этих образцах, можно достаточно



Рис. 1. SEM-изображение скола полированной пластины кремния с осажденным титаном. Темная область — кремний, светлая — титан.





Рис. 2. SEM-изображение шероховатой поверхности кремния и осажденным на нее титаном. Темные области — кремний, более светлые — титан. Масштаб на *b* уменьшен в 250 раз по сравнению с *a*.

точно подсчитать по формуле

$$N = \frac{Sd\rho}{A},\tag{3}$$

где S — площадь, занимаемая пленкой, A — атомная масса Ti, d — толщина пленки, ρ — плотность титана. Из этой пластины вырезали 10 образцов с площадью S от 0.08 до 1.1 сm². В соответствии с расчетом по формуле (2) в этих образцах содержалось от ~ 0.225 \cdot 10⁻⁶ до 2.81 \cdot 10⁻⁶ mol титана. Таким образом, был приготовлен набор образцов с достаточно точно известными микроколичествами титана.

Методом магнетронного распыления титан также осаждался на кремниевую пластину с шероховатой поверхностью, видимая площадь которой составляла 0.7 × 2 ст. Морфология поверхности такой пластины показана на рис. 2. Условия осаждения титана на поверхность кремния отличались от режимов осаждения на полированные пластины кремния (напряжение разряда — 550 V, ток разряда — 170 mA, давление аргона в

камере — 1.73 Ра, магнитное поле на поверхности мишени 0.1 Т, время напыления 8 min). Кроме того, подложка была наклонена к плоскости мишени под небольшим углом ($\sim 10^{\circ}$), что создавало дополнительную неоднородность осажденного слоя титана. На рис. 3 показан скол пластины кремния с шероховатой поверхностью с осажденным на нее титаном. Очевидно, что слой титана, осажденный на шероховатую поверхность, неоднороден по толщине и имеет многочисленные микропустоты, что не позволяет пользоваться формулой (2) для определения количества осажденного титана. Этот образец в дальнейшем использовался для определения микроколичества титана на развитой поверхности кремния.

Для получения градуировочной зависимости ЭДС от растворенного количества титана образцы с точно известными количествами титана обрабатывались в водном растворе плавиковой кислоты с точно известной концентрацией НF (растворе сравнения — PC). Для заметного изменения концентрации ионов H⁺ необходимо, чтобы количество молей HF, участвующих в реакции (1), было сопоставимым с микроколичеством Тi, содержавшегося в пленке. Чтобы избежать трудностей, возникающих при работе с микрообъемами, использовались разбавленные растворы фтористоводородной кислоты ($C_{\rm HF} = 2.25 \cdot 10^{-2}$ mol/dm³). Для обработки образцов использовались растворы объемом 1 cm³. Для гарантированного растворения титана количество фтористоводородной кислоты в исходном растворе должно



Рис. 3. SEM-изображение скола пластины кремния с шероховатой поверхностью и осажденным на нее титаном. Темные области — кремний, светлые — титан. Масштаб на *b* уменьшен в 50 раз по сравнению с *a*.



Рис. 4. Зависимость ЭДС в потенциометрической ячейке от количества растворенного титана, [○] — значения ЭДС, полученные при растворении точно известных микроколичеств титана, [—] — градуировочная кривая (аппроксимация), … • — определение количества титана на развитой поверхности кремния по измеренному значению ЭДС; I — разброс экспериментальных данных.

быть больше, чем требуется в соответствии с реакцией (1). В 1 ст³ водного раствора HF с концентрацией $2.25 \cdot 10^{-2}$ mol/dm³ содержится $2.25 \cdot 10^{-5}$ mol НF, что в 1.33 раза больше количества HF, необходимого для растворения максимального количества Ті (2.81 · 10⁻⁶ mol). Исходный раствор НF с концентрацией $2.25 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3$ объемом 1 cm³ использовался в качестве РС. Образцы обрабатывались в РС до полного растворения Ті. Полученные растворы помещались в потенциометрическую ячейку, где проводилось измерение ЭДС. Время полного растворения титана определялось путем измерения ЭДС, возникающей в потенциометрической ячейке в зависимости от времени обработки образца в РС. Эта зависимость имеет два участка: первый — участок нарастания ЭДС, второй участок, на котором ЭДС не зависит от времени. На первом участке происходит растворение титана. На втором участке ЭДС стационарна, так как реакция (1) завершена, и состав раствора не меняется. Определялось время t_0 перехода ко второму участку, и это время увеличивали в 2 раза. По истечении времени 2t₀ процесс растворения титана гарантированно завершен. Времена to составляли 3-4 h. На рис. 4 показана зависимость ЭДС, возникавшей в измерительной ячейке в зависимости от количества растворенного титана (светлые кружки). Из этой зависимости видно, что с помощью этой методики возможно количественное определение не менее 5 · 10⁻⁷ mol титана. По экспериментальным данным строилась аппроксимирующая кривая (полиномиальная аппроксимация методом наименьших квадратов). Эта кривая использовалась в качестве градуировочной зависимости. Далее производилось измерение количества титана, осажденного на развитую поверхность кремния. Для этого этот образец помещался в измерительную

ячейку, обрабатывался в РС по приведенной выше методике и измерялась ЭДС, возникавшая в потенциометрической ячейке. Величина ЭДС после полного растворения титана составляла 9.1 ± 0.4 mV. По градуировочной зависимости определялось микроколичество титана на развитой поверхности кремния — рис. 4 (пунктирные прямые и черный кружок на графике). На рис. 4 показан также экспериментальный разброс значений ЭДС и соответствующий разброс определяемого количества титана на развитой поверхности кремния. Количество титана, осажденного на развитую поверхность кремния, составляло ~ $(1.6 \pm 0.1) \cdot 10^{-6}$ mol.

Отметим, что, несмотря на большой расход фтористоводородной кислоты в ходе реакции (1), знак ЭДС соответствует увеличению концентрации ионов Н⁺ при растворении Ті, по сравнению с РС. Это можно объяснить тем, что исходный РС содержит только фтористоводородную кислоту HF, имеющую малую константу диссоциации ($K \approx 6.8 \cdot 10^{-4}$). Оценочные расчеты, основанные на элементарной теории электролитической диссоциации [8] показывают, что в 1 ст³ исходного PC содержится $\sim 3.91\cdot 10^{-6}\,mol$ ионов H⁺. При растворении титана в результате реакции (1) образуется комплексная кислота $H_2[TiF_6]$, которая в водном растворе диссоциирует практически полностью, т.е. каждая образовавшаяся молекула H₂[TiF₆] отщепляет в раствор два иона H⁺. Следовательно, в соответствии с реакцией (1) при растворении $2.81 \cdot 10^{-6}$ mol Ti в растворе дополнительно появляется 5.62 · 10⁻⁶ mol ионов H⁺, что превышает начальное количество ионов Н⁺. Если учесть вклад от ионов Н⁺, образующихся в результате диссоциации остатка фтористоводородной кислоты, то концентрация ионов Н⁺ увеличивается приблизительно в 1.75-1.8 раза по сравнению с начальной. Эти расчеты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена при поддержке гранта ГК 16.526.12.6017.

Список литературы

- [1] Мьюрарка Ш. Силициды для СБИС. М.: Мир, 1986, 176 с.
- [2] Ritterskamp P., Kuklya A., Wutskamp M.-A., Kerpen K., Weidenthaler C., Demuth M. // J. Angew. Chem. Int. Ed. 2007. Vol. 4641. P. 7770–7774.
- [3] Иванчев С.С., Мякин С.В. // Успехи химии. 2010 Т. 79. № 2. С. 117–134.
- [4] Bessarabov D., Sanderson R. // J. Membrane Sci. 2004.
 Vol. 244. N 1–2. P. 69–76
- [5] Никитин С.Е., Теруков Е.И., Тимофеев С.В., Манабаев Н.К. // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 6. С. 132-134.
- [6] Berezina N.P., Gnusin N.P., Dyomina O.A., Timofeev S.V. // J. Membrane Sci. 1994. Vol. 86. P. 207–229.
- [7] Демина О.А., Березина Н.П., Анникова Л.А., Демин А.В., Тимофеев С.В. // Сер. Критические технологии. Мембраны. 2007. № 3 (35). С. 11–17.
- [8] Крешков А.П. // Основы аналитической химии. М.: Химия, 1970. С. 46–47.